

2026年3月期 決算説明会・主な質疑応答

決算説明会での主な質疑応答を掲載しています。

開催日時：2026年5月8日（金）

<ご留意事項>

「主な質疑応答」は、説明会での質疑をそのまま書き起こしたのではなく、ご参加いただけなかった方々向けに、当社の判断で簡潔にまとめたものです。

また、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

全社

Q：メモリー価格高騰による影響はどれくらいを見込んでいるのか。

A：数量面では今期必要分の確保の目途はついていますが、価格面は DRAM を中心に前期 Q1 比で数倍まで上昇しています。Q2 以降も高値横ばいを想定しており、今期の営業利益への影響は二桁億円後半と見込んでいます。ただし、サプライヤーから四半期ごとに価格提示される状況もあり、今後さらに追加値上げのリスクもあります。コスト削減を継続しつつ、状況に応じて価格転嫁を検討する可能性もあります。なお、影響は一部ヘルスケア事業にも及びますが、主に映像事業が中心です。

Q：米国関税影響について、関税率の前提と影響額を教えてください。

A：今期の業績予想は、現行の関税率 10%（中国からの輸入は 35%）が継続する前提で策定しています。関税率は低下しているものの、前期は追加関税発効前に米国向け在庫の積み増しを行った効果もあり、今期の会社全体への利益影響額は概ね前期並みになる見込みです。

映像

Q：映像事業の市況が足元で弱い中、今後の利益拡大をどのような施策で実現する想定か。

A：メモリー価格高騰や中東情勢によるダウンサイドリスク、一部成長市場での一服感など外部環境に不透明感があります。一方で、米国・日本ではスマートフォンを活用した撮影・編集・視聴ニーズが拡大しており、当社としては市場全体を悲観的には見ていません。かつて安定的に 400 億円規模の利益を確保していた実績も踏まえ、同事業を安定収益源とするためにも、動画機能を強化して市場を開拓・創出することで、中期経営計画で示している利益水準は実現可能だと考えています。

精機

Q：半導体分野における短期・中期での事業貢献度をどのように見ているか。

A：短期および中期においては、既存の ArF ドライおよび液浸露光装置の拡販が収益拡大の主要ドライバーとなります。これらの装置は依然として需要が堅調であり、最上位クリティカルレイヤー向け ArF 液浸露光装置「NSR-S636E」や昨年度受注を開始した新製品 ArF ドライ露光装置「NSR-S333F」を中心に、複数の大手半導体メーカーより具体的要望や引き合いが増えています。また、後工程アドバンスパッケージング向けのデジタル露光装置「DSP-100」については、初号機の受注を獲得しています。AI を含むサーバー需要の拡大に伴い、従来の後工程向け装置とは異なり、より大型の基板サイズへの対応が求められる中、当社は大面積対応と高精細性能を両立した装置を強みとして市場開拓を進めており、中期経営計画期間の後半にかけてデジタル露光装置市場でのシェア拡大を期待しています。

インダストリー

Q：EUV 関連コンポーネントに関し、「新規需要開拓」や「次世代開発」とは何か。

A：これまでのマスク検査装置は、主に半導体メーカーのマスク製造部門（いわゆるマスクショップ）向けの需要が中心でしたが、現在はウエハファブ、すなわち半導体製造工場での本格導入が進み始めている点が大きな変化となっています。また、将来の EUV 露光装置の高 NA 化・高解像度化を見据え、次世代 EUV コンポーネントの開発も推進しています。

デジタルマニュファクチャリング

Q：デジタルマニュファクチュアリング事業の今期の計画について、売上収益以上に利益が増える要因について教えてほしい。

A：無形資産償却負担の軽減に加え、前期に計上した固定資産の減損損失の剥落、さらにデジタルマニュファクチャリング事業全体の構造改革効果が見込まれます。また、防衛・宇宙分野を中心に大口顧客からのリピートオーダーが継続しており、SLM 社の大型金属 3D プリンターの販売台数増加が期待できます。これにより、製品ミックスの改善を通じて粗利面でも改善効果が見込まれています。

以上